KEK Internal 2016-16 February 2017 A

平成28年度

# KEK 技術賞 受賞論文集

# The KEK Technology Prize 2017

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構

(C) High Energy Accelerator Research Organization

### © High Energy Accelerator Research Organization (KEK), 2017

KEK Reports are available from:

High Energy Accelerator Research Organization (KEK) 1-1 Oho, Tsukuba-shi Ibaraki-ken, 305-0801 JAPAN

 Phone:
 +81-29-864-5138

 Fax:
 +81-29-864-4604

 E-mail:
 irdpub@mail.kek.jp

 Internet:
 http://www.kek.jp

平成 28 年度 KEK 技術賞専門部会 会長 大友 季哉

KEK 技術賞は、「技術への取り組みが創造的であること」、「技術の具体化への貢献、成果が顕著である こと」、「KEK の推進する研究計画への技術貢献が顕著であること」及び「技術伝承への努力が積み重ね られていること」の4項目を基本として、すぐれた技術開発や改良を行われた方を表彰するものです。17 回目となる平成28年度には、3名の応募があり、10名の部会委員による審査を行いました。申請書に加 えて、候補者によるプレゼンテーション及び開発現場での直接説明を受けた審査の結果、機械工学セン ターの岡田尚起氏が平成28年度のKEK技術賞にふさわしいとして、所長会議に技術賞専門部会より推 薦され、岡田氏に同賞を授与することとなりました。

岡田氏は、SuperKEKB における陽電子ビームの大電流化のために必須となるフラックスコンセントレー タの加工方法を開発されました。フラックスコセントレータは、円錐状の穴を貫通させた外形 108mm、長 さ 100mm の無酸素銅の円柱に、0.2mm という狭幅のスリットを螺旋状に設け、そこに 12kA というパルス 大電流を流すことで、収束磁場を発生させるものです。このスリット加工作業は既存の加工技術では極め て困難なものであり、所外で実績がある加工メーカーはどこにもありませんでした。岡田氏は、狭幅のス リットを加工するため、ワイヤーの経路をクランクさせたワイヤーカット放電加工機の実現に取り組まれま した。ワイヤー経路をクランクさせるためのプーリーの改良、系統的な試験による加工条件の最適化など により、目標とする加工精度に加えて、90 時間以上の長時間連続の加工を実現しました。岡田氏の加工 によるフラックスコンセントレータは SuperKEKB の 5ヶ月に及ぶ Phasel 運転に大いに貢献しました。さら に、本技術はワイヤーカット放電加工それ自体の可能性を広げるものと期待できるものです。

残念ながら受賞に至らなかった方々も優れた成果をあげておられ、プレゼンテーションもよく準備され ておりました。技術職員の方々が日々取り組んでおられる業務には、KEK 技術賞にふさわしいものが数多 く存在していると思われますので、ぜひ積極的に本技術賞にチャレンジしていただければと思います。今 後とも、本技術賞に対する関係各位の一層のご理解とご協力をお願い致します。

# 平成28年度 KEK技術賞 受賞論文

# 目 次

序文

受賞論文

# フラックスコンセントレータヘッドの螺旋スリット加工方法の開発

#### DEVELOPMENT OF A SPIRAL CUT METHOD FOR A FLUX CONCENTRATOR HEAD

#### 岡田尚起

Naoki Okada #

#### High Energy Accelerator Research Organization Applied Research Laboratory, Mechanical Engineering Center

#### Abstract

SuperKEKB の陽電子生成量は KEKB のおよそ 4 倍であり、これまでの陽電子の収束に使用していたパルスコイルに代わる新たな収束系としてフラックスコンセントレータを採用した。これに用いられるフラックスコンセントレータヘッドには 0.2mm 幅のスリット加工を螺旋状に行う必要があり、このスリット加工をワイヤー放電加工機で行なった。既存のワイヤー放電加工機ではスリットを螺旋状に加工することができないため、ワイヤー電極をクランクさせる装置を開発し、専用加工機を使用せずに、機械工学センターが所有しているワイヤー放電加工機の能力を最大限に引き出し、安価で高精度な加工を行なうことに成功した。

#### 1. はじめに

SuperKEKBの新たな陽電子の収束系としてフラックス コンセントレータ型パルスソレノイド(Figure 1)が採用され た。陽電子はターゲットに電子ビームを当てることにより 生成されるが、出来た直後の陽電子は大きな角度広がり を持ち、四方へ飛び散ってしまう。これを抑え、効率よく 陽電子を捕集し後段の加速管へ導くために、フラックス コンセントレータヘッドに強力な磁場を発生させ陽電子 を収束させる。今回、一番重要な部品であるフラックスコ ンセントレータヘッドの加工方法を開発し、機械工学セン ターが所有する工作機械を使用し加工を行なったので、



Figure 1: フラックスコンセントレータ型パルスソレノイド



2. フラックスコンセントレータヘッド

フラックスコンセントレータヘッドの形状を Figure 2 に 示す。フラックスコンセントレータヘッドは外径 φ 108mm、 長さ 100mm の無酸素銅の円筒中央にコーン状 (小径 φ 7mm、大径 φ 52mm)の穴があいている。ここに 0.2mm 幅のスリットを 7.257mm 間隔で螺旋状に加工しコイル状 にする。Figure 3、4 に示すように外周部にはスリットに 沿って溝が切られ、電流入力と冷却のため無酸素銅パ イプがロウ付けされる。この無酸素銅パイプに最大 12kA の電流を流すことで内部に強力な磁場を発生させる構 造となっている。フラックスコンセントレータヘッドを加工 する上で重要と考えるポイントを以下に示す。

- 磁場をコントロールするため、スリット幅及びピッ チの精度を±0.1mm以下にする必要がある
- ② 放電を抑えるため表面粗さの向上とエッジ部の バリを抑える必要がある
- ③ スリット加工は無酸素銅パイプをロウ付けした後に行なう必要があり、引出線の処理方法や加工 方法を検討する必要がある



Figure 3: イメージ図(銅パイプ無)



Figure 4: フラックスコンセントレータヘッド

#### 3. 螺旋スリット加工方法の開発

#### 3.1 工作機械の選定

フラックスコンセントレータヘッドで必要なスリットは、幅 が狭く、深さも深いため、スリットを加工できる工具も無く 一般的に知られている工作機械(旋盤やフライス盤等) での加工はほぼ不可能である。仮に工具が存在し加工 が出来たとしても、切り込み量が数µmと微量になるた め膨大な時間がかかり、また軸方向に垂直に高精度な 加工を行なうことはできない。加工業者や工作機械メー カーに螺旋スリット加工について問い合わせてみたが、 加工業者では引き受けてもらえず、工作機械メーカーも 専用機の導入を提案され製作日数や予算的に採用でき なかった。そこで、機械工学センターで所有するワイヤー 放電加工機を改良し加工を行なうこととした。

ワイヤー放電加工機とは、脱イオン水中で工作物と電 極となる真鍮製のワイヤーとの間に放電現象を発生させ ることによって、工作物を溶融除去することで高精度・微 細加工を行なう工作機械であり、以下の特徴がある。

- 導電性があれば、難削材でも加工が容易
- プログラムを組めば複雑な形状でも加工可能
- ワイヤー電極に電気を放電させて加工する非接 触加工のため、機械的な圧力が加わらず変形や 歪みが発生しない
- バリの発生がほぼない
- ワイヤー電極は使い捨てで、常に新しいワイヤー 電極が供給される
- 通常 0.2~0.3mm のワイヤーが使用される

既存のワイヤー放電加工機ではワイヤー電極が垂直 に張られているためスリット加工を螺旋状に行なうことが 出来ない。そこで、機械工学センターで所有しているワイ ヤー放電加工機に改良を加えることで、低予算で要求さ れる精度を達成する加工方法を開発した。

3.2 ワイヤークランク装置の構造

Figure 5 に今回開発したワイヤークランク装置を示す。

ワイヤー電極は 0.15mm の真鍮ワイヤーを使用した。 ワイヤークランク装置は水中で使用されるためステンレス 材を使用し、下ノズルのネジ部に取付ける構造とした。こ れにより容易に交換が可能となった。アーム部は円錐状 の穴に通すため先端部を細くし、根元部は出来るだけ太 くし剛性を上げた。アームの高さは回転中心に位置し、 長さを 130.9mm とし、下側ワイヤーに角度をつけること で、ワイヤークランク装置とフラックスコンセントレータヘッ ドが干渉しないように設計した。また、アームの先端部は φ7mm の内径に通すためプーリーが取り付けられない。 そこで半割にしたガイド(Figure 6)によりワイヤー電極を 曲げる構造とした。ガイドは摩擦による消耗を抑えるため、 耐摩耗性のあるサファイヤを採用しアラルダイトにより接 着し固定した。後端部のガイドは、絶縁が必要と考えマ シナブルセラミックスのプーリーを製作しすべり軸受のガ イドとした。しかし、摩擦によるガイド部や軸受部の摩耗 によりワイヤーテンションが乱れ加工が困難となった。 Figure 7 に示すようにプーリーの材質や軸受構造をいろ いろ試した結果、ワークとワイヤー電極は絶縁されている ため、導電性があっても良いことがわかりステンレスの プーリーとボールベアリングによるガイドを採用した。これ によりワイヤーテンションの乱れが抑制され断線が軽減さ れた。ただ、スラッジ(加工層)によるボールベアリングの 摩耗は防げないため、1日に1回はベアリングの交換が 必要となる。



Figure 5: ワイヤークランク装置



Figure 6: サファイアガイド



Figure 7: プーリー

3.3 ワイヤーカット放電加工機への設置

今回、機械工学センターで所有しているワイヤー放電 加工機「FANUC ROBOCUT  $\alpha$ -1iD」を使用し、Figure 8 に示すように回転テーブルとワイヤークランク装置を取 り付けて加工を行なった。



Figure 8: 螺旋スリット加工の概念

加工が進むにつれスラッジ(加工屑)が内部に滞留して しまうため、Figure 9 のようにホースで裏から水を流すこと で滞留を防ぎワイヤーの断線を軽減することが出来た。



Figure 9: スラッジの滞留防止策.

3.4 ワイヤー電極の位置出し

ワイヤークランク装置を取り付けた状態では加工部の ワイヤー電極は垂直になっていないため垂直出しを行な う必要がある。そこで、Figure 10 示すように回転テーブ ルに位置出し用の治具を取り付け機上で高精度な位置 出しが可能な方法を考案した。U・V 軸をあらかじめ少し 傾け Figure 11 に示す部分で距離を測定し、傾きを徐々 に戻していき、測定値が最大となる位置を垂直とするよう に位置出しを行なった(Figure 12)。

これにより、軸方向および径方向のワイヤーの垂直を 0.01mm/80mm 以下に追い込んだ。また、同時に回転 軸との中心出しも行なった。



Figure 10: クランク装置の中心出し



Figure 11: 垂直出し治具



Figure 12: 垂直出しの方法(U・V 軸共通)

#### 3.5 最適な加工条件の選定

ワイヤークランク装置を使用することで、メーカー推奨 の加工条件では加工ができない。そこでまずは加工試 験(Figure 13)行なうことにした。直線部の加工は可能で あったが、螺旋部の加工に入ると放電が安定しないため ワイヤーが頻繁に断線した。螺旋形状を加工するために は回転運動(回転軸)と直線運動(X 軸)の 2 軸を同時 に制御して加工する必要がある。ワイヤー放電加工機で は放電ギャップを一定に保ちながら加工が進められるよ うに制御が行なわれているが、回転軸に対しては径によ り周速が異なるため本機の制御系では放電ギャップを一 定に制御できないことが分かった。さらに、スリット幅精度 や放電面の表面粗さを向上させるために通常数回に分 けて加工を仕上げる必要があるのだが、螺旋状に加工 することで自重によるたわみを生じることが考えられるた め、一度の加工で仕上げる必要がある。そこで加工試験 を通して、最適な加工パラメーターの選定と加工精度・ 表面粗さの確認を行なった。

数十通りのパターンで加工試験を行なった結果、メー カー推奨の加工条件よりも低い条件(X 軸に進む速度を 遅くすることによって周速を遅くし、放電ギャップが保てる 速度にした)で加工することにより、放電ギャップを一定 に制御し安定した加工を実現できた。加工日数としては 5日程度で実加工時間は約90時間であった。加工後に シックネスゲージによりスリット幅を計測した結果、スリット 幅は 0.2~0.25mm で加工され、0.2mm±0.1mm の公差 内に収めることができた。加工面の表面粗さも 3.9 μ mRa を得ることができた。(Figure 14)



Figure 13: テスト加工(銅パイプ無)



Figure 14: 加工面(洗浄前)

#### 3.6 実機の加工

実機の加工始めでは、Figure 15 のように引出部を結 東バンドで固定することでワイヤー電極やクランク装置に 干渉するのを防いだ。加工が進むにつれクランク装置と 銅パイプが近づくので Figure 16 のように本体に巻きつ けることで干渉を防いだ。



Figure 15: 加工開始時



Figure 16: 加工終了付近

#### 4 まとめ

#### 4.1 実機の加工と結果

今回初めてフラックスコンセントレータヘッドの加工に 取組み、開発したワイヤークランク装置を用いることに よって従来では加工ができなかった形状の製品を要求さ れる加工精度で加工することが可能となった。加工条件 を Table 1 に示す。また、初期の段階では実加工時間は 約 60 時間であったが、断線が多く日数としては 2 週間 程度かかっていた。しかし、最適な条件を見つけることが でき、加工時間は約 90 時間と1.5 倍になったが、一度も 断線することなく加工ができ、完了するまで 1 週間程度 と半分に短縮することができた。

加工回数(NUM)	1
パルスモード(PM)	11
無負荷電圧(VS)	3
電流制御(CC)	12
加工電圧(VM)	16
オン時間(ON)	2
オフ時間(OFF)	75
AC加工(AC)	1
サーボモード(SVM)	1
サーボ電圧(SV)	20
サーボゲイン(SVG)	50
パワー制御A(WP1A)	20
パワー制御B(WP1B)	0
オフ時間制御A(WP2A)	8
オフ時間制御B(WP2B)	0
ワイヤ張力(T)	500
ワイヤ速度(WF)	11
加工液量(FR)	11
加工液制御(FC)	0
設定送り速度(SPD)	0.8
仕上げパルス制御(SPC)	
コーナ制御(AIC)	3003
上下オフセット(STOFST)	0
送り速度オーバライド(%)	60

Table 1: 加工条件

#### 4.2 フラックスコンセントレータヘッドの運転・成果

フラックスコンセントレータヘッドは 2012 年から現在までに 10 台製作した。3 号機は陽電子生成標的や補助用の DC ソレノイドなどを一体化したアセンブリに組み込み、実際のビーム運転に使用するために 2014 年 4 月に電子陽電子入射器トンネル内のビームラインに設置した。続いて 5 月より運転を開始し所定の磁場強度を達成し陽電子ビームの生成に成功した。Figure 17、18 の測定結果より、定格電流の半分ではあるが問題なく磁場も発生し陽電子が生成されているのがわかる。



Figure 18: 電流値を増やした時の陽電子生成量

2016年2月よりSuperKEKBはphase1運転を開始した。phase1ではリングのビームパイプを蓄積した荷電粒子からの放射光で焼き出し、真空度を向上させるということが大きな目標の一つであった。そのためには入射器から安定で、十分な量のビーム供給が不可欠であるが、本件で開発したフラックスコンセントレータは約5ヶ月間の運転において、ほぼ休むことなく、陽電子ビームを供給し続け、phase1運転の目標達成に対し、中心的役割をはたすとともに、大きく貢献した。



Figure 19: ビームラインに組込まれた様子

4.3 本技術の発表、伝承状況

本技術の成果は機械工学センター内で報告し、平成 24 年度愛媛大学総合技術研究会で「フラックスコンセン トレーターの螺旋加工の開発」として発表した。

加工テストの結果等はログノートに記録し、技術資料と してまとめた。例えば企業や他者に技術移転する場合は、 スムーズに対応できる。

#### 5 謝辞

技術賞に推薦していただいた加速器研究施設の榎本 嘉範氏に感謝いたします。また、フラックスコンセントレー タの開発に携わっている加速器研究施設および機械工 学センターの多くの方々に感謝します。

#### 参考文献

- L. Zang et al., "Design Optimization of Flux Concentrator for SuperKEKB", IPAC'12, New Orleans, USA, May 2012, TUPPD032
- [2] L. Zang et al., "Design Study of a New Large Aperture Flux Concentrator", IPAC'13, Shanghai, China, May 2013, MOPFI018
- [3] T. Kamitani et al., "SuperKEKB Positron Source Construction Status", IPAC'14, Dresden, Germany, June 2014, MOPRI004
- [4] T. Miura et al., "Progress of SuperKEKB", IPAC'15, Richmond, VA, USA, May 2015, TUYB1
- [5] M. Satoh et al., "Commissioning Status of SuperKEKB Injetor Linac ", IPAC'16, Busan, Korea, May 2016, THPOY027
- [6] <u>岡田尚起</u>、高富俊和、小林芳冶、"フラックスコンセントレー タの螺旋加工の開発"、平成 24 年度愛媛大学総合技術 研究会、松山、2013.
- [7] <u>岡田尚起</u>、高富俊和、小林芳冶、"フラックスコンセントレー タの螺旋加工の開発"、第 14 回 メカ・ワークショップ報 告集、KEK, 2013, 99-101.
- [8] 紙谷琢哉、<u>岡田尚起</u>、他 57 名、" SuperKEKB 陽電子源 の初期コミッショニングの現状"、第 11 回日本加速器学会 年会、青森、2014, 272-276.
- [9]周翔宇、<u>岡田尚起</u>、他 60 名、"KEK 電子陽電子入射器の

現状"、第 12 回日本加速器学会年会、敦賀、2015,344-348.

- [10]紙谷琢哉、<u>岡田尚起</u>、他 56 名、"SuperKEKB 陽電子増 強の現状"、第 12 回日本加速器学会年会、敦賀、2015, 1064-1068.
- [11]榎本嘉範、紙谷琢哉、高富俊和、<u>岡田尚起</u>、横山和枝、 田中窓香、肥後寿泰、"電子陽電子入射起用フラックスコ ンセントレータの開発"、第 17 回メカ・ワークショップ報告 集、KEK, 2016, 15-17.
- [12] 榎本嘉範、紙谷琢哉、高富俊和、<u>岡田尚起</u>、横山和枝、 田中窓香、肥後寿泰、牛本信二、"SuperKEB 用フラックス コンセントレータの開発"、第 13 回日本加速器学会年会、 千葉、2016,520-523.

参 考

#### 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構

### 技術者表彰規程

平成20年12月26日 規程第51号

(趣旨)

第1条 この規程は、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構職員就業規則

(平成16年規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第66条第2号の規定に 基づき、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(以下「機構」という。) に勤務する技術職員の表彰に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の名称)

第2条 表彰の名称は、KEK技術賞とする。

(表彰の方法)

第3条 所長、施設長及び施設部長は、所属する技術職員が職員就業規則第66条第2 号に該当すると思慮されるときは、機構長が指定する期日までに機構長に申請するも のとする。

(表彰対象者の審査)

- 第4条 表彰対象者の審査は、所長会議が行うものとする。
- 2 所長会議に、具体的な審査をするため、専門部会を置くことができる。

(表彰状の授与)

- 第5条 表彰は、機構長が別紙様式による表彰状を授与することにより行う。
- 2 前項の表彰状に併せて、記念品を贈呈することができる。

(規程の進用)

第6条 この規程は、機構に勤務する事務補佐等職員、パートタイム職員、再雇用職員 にも準用する。

(実施規定)

第7条 この規程に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この規程は、平成20年12月26日から施行する。

### 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構

### 職員就業規則

# ( 平成16年4月1日 規則第1号

#### 第7章 賞罰

(表彰)

第66条 機構長は、次の各号の一に該当すると認められる職員を表彰する。

- (1) 業務上特に顕著な功績があった者
- (2) 業務上特に有益な発明若しくは開発又は改良をした者
- (3) 機構に永年にわたり勤務し、その勤務成績が特に良好な者
- (4) 業務遂行上特に職員の模範として推奨すべき行為があった者
- (5) その他機構長が特に認める者

KEK 技術賞受賞者一覧

年 度	受賞課題名	氏 名	所 属
平成12年度	アトラス・シリコンストップ・モジュールの 開発	高力 孝	素粒子原子核研究所
	PFビームライン・インターロックシステム とその集中管理システムの開発	小菅隆	物質構造科学研究所
	ヘリウム液化冷凍機の連繋運転と制御システ ムの自動化	大畠 洋克 飯田 真久	共通基盤研究施設
	卓越した超精密加工技術	高富一俊和	共通基盤研究施設
平成13年度	中性子散乱用位置敏感検出器、PSD2Kシ ステムの開発	佐藤 節夫	物質構造科学研究所
	LHC用強収束超伝導四極電磁石の開発	寺島     昭男       東     憲男	共通基盤研究施設
	BELLE検出器用鉄構造体の開発	山岡広	素粒子原子核研究所
平成14年度	ニュートリノビームライン用電磁ホーンシス テム	山野井 豊 鈴木 善尋	素粒子原子核研究所
平成15年度	PFリング入射用 6.25Ω伝送線型キッ カーマグネット及び電源システムの開発	上田明	加速器研究施設
	Belleシリコンバーテックス検出器 (SVD)の構造設計と製作	工作センターSVD エンジニアリンググ ループ(小池重明、 大久保隆治、佐藤伸 彦、鈴木純一)	共通基盤研究施設
平成16年度	該当者なし		
平成17年度	大電力高周波加速空洞の空気冷却装置の開発	戸田 信	加速器研究施設
	パイプライン機能とネットワークインター フェースを持つ高速CAMACインター フェース	安 芳次 井上 英二	素粒子原子核研究所
	ブースター周辺のビームモニターの開発	染谷 宏彦	加速器研究施設
平成18年度	音波を用いたガス検出器の開発	近藤 良也	素粒子原子核研究所
	K2K実験サイバー検出器用フロントエンド 読出し回路の開発	村上 武	素粒子原子核研究所
	マイクロチャンネル結晶の開発	内田佳伯	物質構造科学研究所
	粒子加速器・物理実験用超伝導低温機器にお けるTIG自動溶接技術の開発	安島泰雄	共通基盤研究施設

年 度	受賞課題名	氏名	所 属
平成19年度	MO 型フランジのアンテチェンバーへの応用	白井 満	加速器研究施設
	長尺ビームダクト用 TiN コーティング装置の 開発	久松 広美	加速器研究施設
	4 GHz10bitADC モジュールの開発	池野 正弘	素粒子原子核研究所
平成20年度	DAQ ミドルウェアを基盤としたネットデータ収 集システムにおけるクラス及びデータベース設 計と実用化-MLF/J-PARC への DAQ ミドルウェア の適用	仲吉一男	素粒子原子核研究所
	マイクロパターンガス増幅検出器用フロント エンド ASIC の開発	藤田陽一	素粒子原子核研究所
	J-PARC 3NBT ビームライン電磁石及び高耐放射 線性を有するM1、M2電磁石の三次元詳細計算 による設計の最適化	藤森 寛	物質構造科学研究所
	J-PARC の MLF 子実験装置に於ける、ネットワー ク化した NEUNET 中性子計測システムの開発	佐藤節夫	物質構造科学研究所
平成21年度	J-PARC におけるミュオン生成標的の開発	牧村俊助	物質構造科学研究所
	水素炉を用いた金属接合技術の開発	工藤 昇	共通基盤研究施設
	TO チョッパー制御・計測システムの開発	下ヶ橋一秀典	物質構造科学研究所
	EPICS on F3RP61の開発と応用	小田切淳一	加速器研究施設
	J-PARC Main Ring のシステムコミッショニング	大越隆夫	加速器研究施設
平成22年度	2 ギャップバンチャーを用いた鋸歯状波電圧 による新バンチング技術の開発	岡田雅之	加速器研究施設
	International Linear Collider のための超 高速キッカーの開発	内藤 孝	加速器研究施設
	J-PARC ビームライン超伝導システム用ヘリウ ム冷凍設備・省電力運転モードの構築	大畠洋克	共通基盤研究施設
	J-PARC ハドロンビームラインにおける大強度 ビームダンプの開発	上利恵三	素粒子原子核研究所
	ギガビットネットワークを持つ時間測定システ ムの開発 -COPPER-LITE と FINESSE TDC-	田内 一弥 齋藤 正俊	素粒子原子核研究所
	メッセージ配信システム STARS の開発と放射 光ビームライン制御システムへの応用	小菅隆	物質構造科学研究所

年 度	受賞課題名	氏名	所 属
平成23年度	高エネルギー加速器施設における放射線管理の ための数え落としのない放射線モニターの開発	飯島和彦	共通基盤研究施設
	結晶格子コンパレターのための回転機構の設 計と製造	高富俊和	共通基盤研究施設
	小型冷凍機を用いた粒子検出器用無冷媒超伝 導ソレノイドの開発	川井 正徳	素粒子原子核研究所
	BELLE Ⅱ中央飛跡検出器用フロントエンド集 積回路の開発	島崎 昇一	素粒子原子核研究所
	J-PARCハドロン実験ホールにおける新 型静電粒子分離装置の開発	皆川道文	素粒子原子核研究所
平成24年度	KEKBの加速モードに起因する結合バンチ不 安定を抑制するフィードバックシステム	吉本 伸一	加速器研究施設
	J-PARC 一次ビームラインにおける即着脱冷却 水コネクタの開発	広瀬 恵理奈	素粒子原子核研究所
	二結晶型波長分散XAFSシステムの開発	丹羽 尉博	物質構造科学研究所
平成25年度	該当者なし		
平成26年度	DAQ-Middleware の高度化と素粒子原子核・物 質生命科学分野への普及活動	千代 浩司	素粒子原子核研究所
	高輝度真空紫外軟X線ビームラインの建設・調 整法と光学素子の in situ 炭素汚染除去法の開発	豊島 章雄	物質構造科学研究所
	大強度陽子ビームの高ダイナミックレンジのハロー 診断のための OTR/Fluorescence スクリーンを用いた 2 次元ビームプロファイルモニター	橋本義徳	加速器研究施設
平成27年度	国際リニアコライダーのための低エミッタンス 極小電子ビーム技術開発に必須な加速器アライ メント技術開発に対する貢献	荒木 栄	加速器研究施設
	E 36 冷却システムの再構築ならびに J-PARC 大型 Helium 低温設備の集中管理制御システムの確立	大畠洋克	共通基盤研究施設
平成28年度	フラックスコンセントレータヘッドの螺旋ス リット加工方法の開発	岡田 尚起	共通基盤研究施設

## 後書き

KEK 技術賞は、高エネルギー加速器研究機構における技術上の優れた業績を表彰し、もって広く技術の発展に資することを目的として平成 12 年度に創設されました。

推薦された技術賞候補案件は、各研究所、研究施設、技術職員から選出された委員による「KEK 技術 賞専門部会」において選考され、所長会議で決定されます。所長会議に部会として推薦する候補者の選 考は、各候補者によるそれぞれの技術内容紹介と技術開発現場での内容説明を踏まえて、部会における 審議により行われました。その際、候補者毎に部会委員のなかからチーフレビューアーの(正)(副)を 選任し、必要に応じて候補者より追加情報を提出していただくなど、技術賞の審査基準に照らして候補者 の業績の意義をより引き出すべく検討を行いました。審査基準は、これまで積み上げられてきた審査に 対する基本的な考え方を踏まえ、以下の4項目を基本としています。

- (1) 技術への取り組みが創造的である
- (2) 技術の具体化への貢献、成果が顕著である
- (3) KEKの推進する研究計画への技術貢献が顕著である
- (4) 技術伝承への努力が積み重ねられている

KEK 技術賞の募集は、6月から10月初旬までを公募期間としており、年内には受賞者を決定いたします。 受賞論文は、KEK インターナル・レポート(本冊子)として出版され、広く関係者等にも配布されています。

KEK 技術賞専門部会

